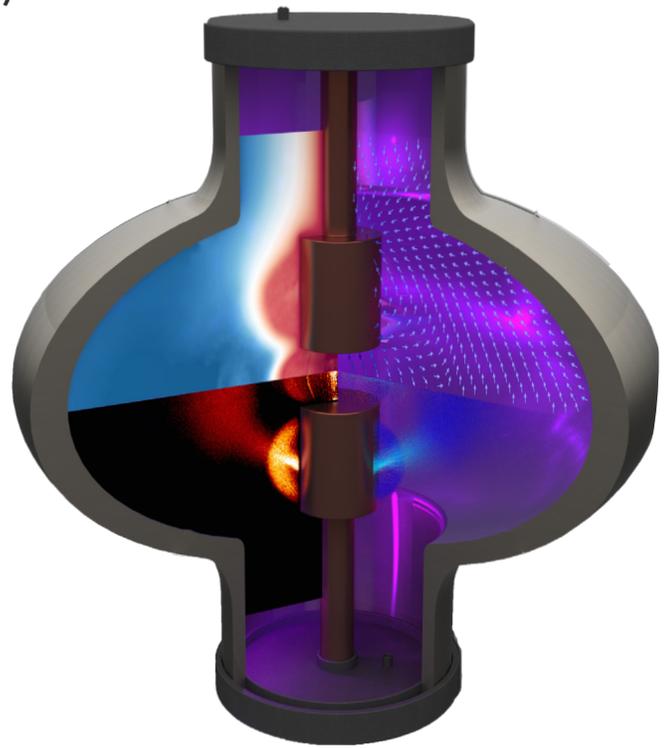


VSImPD

最全面的電漿模擬解決方案

VSImPD 是一款多功能且功能強大的粒子式 (PIC) 模擬軟體，專為電漿模擬優化的應用程序。VSImPD 可在任意氣體壓力背景下直接追蹤各種動態粒子行為，包括電子、離子和中性粒子之間彈性、激發和電離碰撞的效應。

使用 Tech-X 專有的切網格 (cut-cell) 演算法，結合 VSim 的獨特方法，使用 FDTD 和 PIC 方法，VSImPD 可快速準確地模擬複雜粒子多維度的動態行為。強大的後處理能力可讓使用者進行穩健分析，並且由於 VSim 設計為可進行平行運算，可以很容易將其安裝在高性能計算系統。最初由 Tech-X 的科學家創建，他們仍是電漿和計算物理領域的主要貢獻者，VSImPD 是最全面的電漿模擬解決方案。

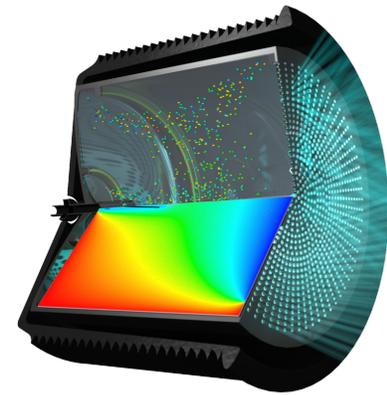


“此軟體的很大一部分價值在於我們獲得的技術支援和協助建立離子源模型。這讓 VSim 對我們的研究非常有用。”

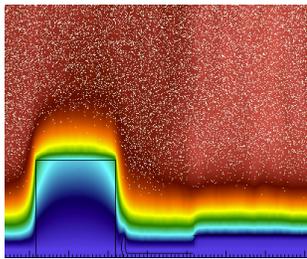
—Bruce Marsh, 歐洲核子研究中心

VSimPD 優勢:

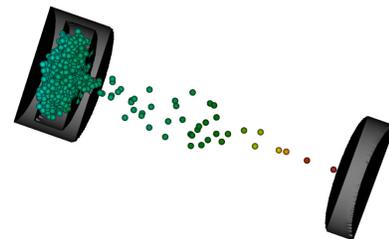
- 用於複雜模擬的 FDTD 程式
- 用於電漿動力學模擬的 PIC 演算法
- 準二階精度
- 全套反應類型可用於深度分析
- 強大的後處理
- 高性能計算能力
- 與所有 VSim 模組無縫整合
- 強大的文件和教程



固定式電漿推進器



電漿晶圓蝕刻



從Penning離子源中萃取離子

VSimPD 的應用



電漿蝕刻



電漿清洗



電漿增強化學
氣相沉積



電漿推進器



磁控濺鍍



直流和射頻濺鍍



離子源



衛星表面充電

技術支援

許多我們的客戶將我們的軟體用於新穎的應用而我們訓練有素的應用工程師擁有物理和工程專業知識來支援他們的需求。每個 Tech-X 軟體授權購買包含了支援時數，以便客戶可以充分利用我們模擬產品的強大功能。

關於 Tech-X 公司

Tech-X 公司致力於技術卓越和創新。我們的科學家和軟體工程師通力合作以提供可量化的結果。我們結合學術研究與商業軟體公司的敏感度，利用最新的硬體和軟體進步發展的優勢以提供高品質的尖端軟體。